

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОНОВ НА ГЕТЕРОГРАНИЦЕ ВТОРОГО ТИПА

*A.H.Баранов, A.A.Гусейнов, A.A.Рогачев, A.H.Титков,
B.H.Чебан, Ю.П.Яковлев*

Обнаружена локализация фотоэлектронов в двумерной потенциальной яме на гетерогранице второго типа в системе $p\text{-GaInAsSb} - p\text{-GaSb}$. Показано, что энергия локализации электронов в яме определяется уровнем легирования узкозонного слоя и увеличивается при его снижении. Заселенность ямы немонотонно зависит от температуры, проходя через максимум в области 20 – 50 К. Обнаружено сильное влияние на заселенность ям внешнего магнитного поля параллельного гетерогранице.

В полупроводниковых структурах на гетерогранице второго типа разрывы зон проводимости и валентной имеют одинаковый знак. Это приводит к необычной ситуации, когда по разные стороны от гетерограницы возникают самосогласованные потенциальные ямы, локализующие носители разного знака, т.е. гетерограница разделяет электроны и дырки. Энергетическая схема такой гетерограницы на примере изотипного $p - p$ -гетероперехода приведена на рис. 1. Глубина возникающих ям определяется величинами разрывов энергетических зон (в данном случае валентной зоны) и может во много раз превосходить kT . В структурах с достаточно резкой гетерограницей такие ямы должны являться эффективными каналами сбора и рекомбинации неравновесных носителей.

В настоящей статье сообщается о первом наблюдении локализации и рекомбинации электронов в двумерной потенциальной яме на гетерогранице второго типа на примере структуры $p\text{-Ga}_{0.8}\text{In}_{0.2}\text{As}_{0.18}\text{Sb}_{0.82} - p\text{-GaSb}$. Структуры приготавливались методом жидкофазной эпигексии слоев $p\text{-GaInAsSb}$, различно легированных акцепторной примесью германия, на нелегированной подложке $p\text{-GaSb}$ (111)B. Концентрация собственных акцепторов в $p\text{-GaSb}$ составляла $2 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$, а уровень легирования слоя GaInAsSb менялся в пределах $p = 10^{17} \div 10^{18} \text{ см}^{-3}$. Возбуждение структур осуществлялось со стороны слоя GaInAsSb , имевшего толщину 1,5 мкм, линией He – Ne-лазера с энергией кванта 0,815 эВ.

На рис. 2a и б приведены спектры люминесценции структур с разными уровнями легирования слоя GaInAsSb . При выбранных уровнях легирования состояния мелкого акцептора германия являются вырожденными и сливаются с валентной зоной. Поэтому в спектрах следовало ожидать присутствия только одной полосы, отвечающей межзонным переходам в узкозонном слое GaInAsSb . На самом деле, наряду с межзонной полосой A в спектре обнаруживается еще одна полоса, смещенная в сторону меньших энергий. При увеличении плотности возбуждения смещение новой полосы относительно полосы A уменьшается. Отмеченные обстоятельства позволяют связать происхождение новой полосы с локализацией фотоэлектронов в потенциальной яме на гетерогранице. Возникающий в этом случае двумерный характер электронных состояний был непосредственно подтвержден в экспериментах во внешнем магнитном поле. Оказалось, что смещение максимума новой полосы в поле существенно зависит от ориентации поля относительно гетерограницы (см. рис. 3). При перпендикулярной ориентации максимум полосы смещается в сторону больших энергий линейно с полем, а при параллельной заметного смещения не наблюдается. В то же время максимум полосы A испытывает одинаковый и больший сдвиг при обеих ориентациях поля.

Дополнительным свидетельством локализации электронов в яме на гетерогранице явился обнаруженный эффект подавления новой полосы магнитным полем параллельным гетерогранице (см. рис. 2a и б). Исчезновение новой полосы сопровождается соответствующим разгоранием объемной полосы A. Наблюдаемый эффект мы объясняем замедлением в магнитном поле диффузии электронов к гетерогранице, что уменьшает заселенность приграничной ямы.

и соответственно увеличивает концентрацию электронов в объеме слоя GaInAsSb. Важность диффузионного притока электронов для увеличения заселенности ямы непосредственно проявилась в температурной зависимости интенсивности новой полосы. Увеличение температуры от 2 К до 20 – 50 К приводило к разгоранию новой полосы в несколько раз, тогда как интенсивность полосы A снижалась. Разгорание новой полосы естественно объяснить ростом с температурой подвижности и, соответственно, длины диффузии электронов. При больших температурах начинала падать интенсивность и новой полосы.

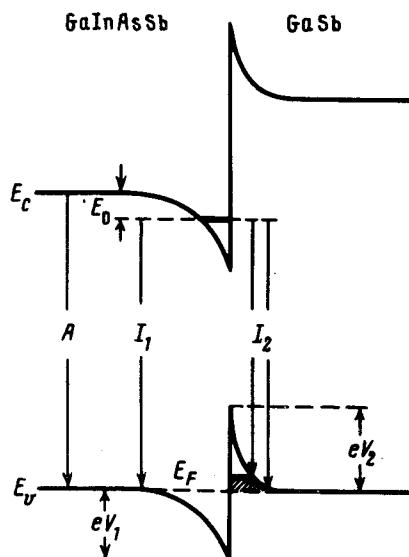


Рис. 1. Схема энергетических зон и рекомбинационных переходов на гетерогранице второго типа изотипной $p-p$ -гетероструктуры

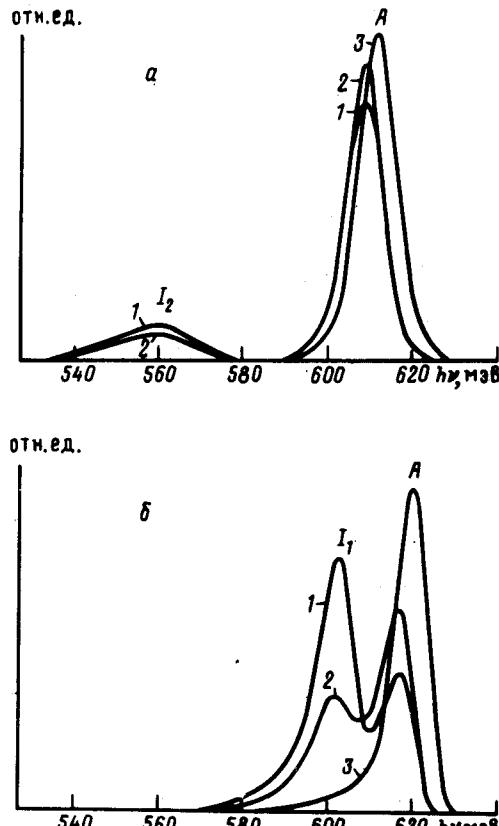


Рис. 2

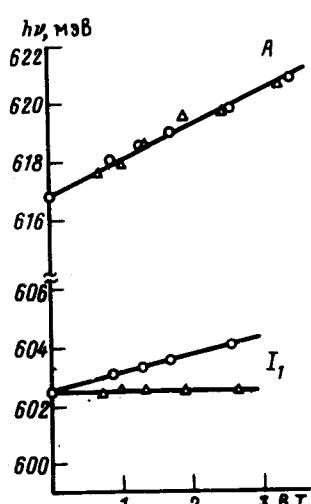


Рис. 3

Рис. 2. Спектры люминесценции при 4,2 К структур $p\text{-Ga}_{0,8}\text{In}_{0,2}\text{As}_{0,18}\text{Sb}_{0,82} - p\text{-GaSb}$ с уровнями легирования слоя GaInAsSb $p = 1 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$ (а) и $8 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$ (б): 1 – в отсутствии магнитного поля, 2 – $B = 0,3 \text{ Т}$, 3 – $B = 3 \text{ Т}$. Плотность возбуждения 10 мВт/см^2

Рис. 3. Сдвиг в магнитном поле полос люминесценции в спектре на рис. 2 б: \circ – поле перпендикулярно гетерогранице, Δ – поле параллельно гетерогранице

Мы провели оценку энергии локализации электронов в приграничной потенциальной яме. На границе исследованной изотопной $p-p$ -структурой образуется двойной заряженный слой, состоящий из квазидвумерного слоя дырок со стороны GaSb и области объемного заряда акцепторов в слое GaInAsSb. Из условия постоянства уровня Ферми, считая, что расстояние от уровня Ферми до края валентной зоны много меньше разрыва валентной зоны Δ (согласно¹ принималось, что $\Delta = 0,15$ эВ), имеем

$$eV_1 + eV_2 = \Delta,$$

$$eV_2 = 2,36 \left(\frac{\hbar^2}{2m_h} \right)^{1/3} \left(\frac{4\pi e^2}{\epsilon_1} \sqrt{\frac{\epsilon_1 V_1}{2\pi e}} - p \right)^{2/3}. \quad (1)$$

Здесь eV_2 – часть поверхностного изгиба зон, находящаяся в GaSb, вычисленная авриационным методом в приближении Хартри², eV_1 – часть поверхностного изгиба зон, относящаяся к области объемного заряда в слое GaInAsSb. Решая уравнения (1) при подстановке необходимых параметров согласно³, мы находили величину eV_1 , которая является глубиной потенциальной ямы электронов в слое GaInAsSb. Положение квантового уровня для электронов в яме E_0 находилось путем численного решения уравнения Шредингера. Таким образом определялось энергетическое смещение новой полосы по отношению к межзонным переходам в объеме слоя GaInAsSb. В частности, при $p = 1 \cdot 10^{17}$ см⁻³ и $8 \cdot 10^{17}$ см⁻³ были получены оценки E_0 равные 50 и 10 мэВ, соответственно, что находится в близком согласии с экспериментально наблюдаемыми смещениями на рис. 2а и б. Проведенный расчет приводит к важному качественному выводу об уширении и углублении потенциальной ямы для электронов при снижении уровня легирования узкозонного слоя и, соответственно, о более сильной локализации электронов в яме.

Электроны, локализованные на гетерогранице второго типа имеют возможность рекомбинировать с дырками по обе стороны от нее (см. рис. 1). Рекомбинация с дырками в объеме узкозонного слоя (переходы I_1) более вероятна при высоких уровнях легирования слоя, так как при этом, во-первых, возрастает количество дырок и, во-вторых, уменьшается глубина электронного уровня в яме и, соответственно, волновая функция электронов проникает дальше в глубь слоя. Снижение уровня легирования должно приводить к преобладанию рекомбинации электронов с дырками, локализованными в самосогласованной яме по другую сторону от гетерограницы (переходы I_2). Нам представляется, что спектры на рис. 2а и б относятся к этим двум разным случаям. На рис. 2б новая полоса и полоса A имеют одинаковые полуширины и форму, что должно быть характерно для переходов I_1 . На рис. 2а новая полоса вдвое шире полосы A , что может быть связано с более широким энергетическим расположением локализованных дырок, проявляющимся в случае переходов I_2 .

Литература

1. Nakao M., Yashida S. Sol. St. Comm., 1984, 49, 663.
2. Андо Т., Фаулер А., Стерн Ф. Электронные свойства двумерных систем, М.: Мир, 1985.
3. Landolt-Börnstein Tables, 7a. Ed. by O. Madelung, M. Schilz and H. Weiss, Berlin, 1982.